

2019年9月12日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社  
東証第1部コード6920  
横浜市港北区新横浜2-10-1  
代表者名 代表取締役社長 岡林 理  
発表担当 経営企画室 室長 浅井 浩志

**新製品 アクティニック EUV パターンマスク欠陥検査装置**  
**ACTIS「A150」を発表**

**【概要】**

この度レーザーテックは、EUV マスクのパターン検査に対応した欠陥検査装置 ACTIS「A150」を製品化いたしました。同装置は9月15日から米国で開催されるフォトマスク技術に関する国際学会である SPIE Photomask Technology + EUV Lithography 2019 にて発表いたします。

**【内容】**

レーザーテックは、1976年に世界初の自動フォトマスク欠陥検査装置を開発し、マスク検査の分野で長い歴史と経験を持つ会社です。現在販売中のマスク欠陥検査装置 MATRICES シリーズは、その優れた欠陥検出性能により、全世界のウェハファブやマスクショップにてご好評いただいております。

一方、デバイスパターンの微細化に伴い、次世代露光技術である EUV リソグラフィによる量産が開始され、当社は EUV マスクへのあらゆるご要求に対応するため、2013年に EUV マスク裏面検査/クリーニング装置「BASIC シリーズ」、2017年に EUV マスクブランク欠陥検査/レビュー装置 ABICS「E120」、そして2018年に EUV マスク欠陥検査装置 MATRICES「X8ULTRA シリーズ」を製品化いたしました。

EUV 光を用いたアクティニックパターン検査装置はこれまで製品化されておらず、ウェハの歩留り向上に必要な EUV マスク製造インフラ構築上の課題となっていました。今般当社がその製品化に成功したことによってこの課題が克服され、EUV リソグラフィの量産適用に必要な装置が出揃うことになります。

新たに開発した EUV マスク欠陥検査装置 ACTIS「A150」は、長年培ったマスクパターン検査技術と EUV 光による検査技術を利用した世界初の EUV パターンマスク欠陥検査装置です。波長の短い EUV 光を用いた検査方式を採用しているため、従来の DUV レーザーを用いたマスク検査機に比べ圧倒的に欠陥検出感度が高く、さらに EUV マスク特有の転写性位相欠陥の検出も可能です。

今後も、EUV リソグラフィを用いて量産する最先端半導体メーカーのご要望にお応えし、EUV リソグラフィ全般にわたる検査装置ラインナップを揃え、業界発展のために貢献してまいります。



ACTIS A150

◇お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第3ソリューションセールス部 部長 森泉幸一

TEL:045-478-7337 FAX:045-478-7333

E-mail: [sales@lasertec.co.jp](mailto:sales@lasertec.co.jp)